

E3630

新型多影像量测CDSEM
支持下一代高精度光掩模的量测需求



E3630是一款基于SEM的新一代光掩模和图形介质的多影像量测系统。该量测系统是专为32nm工艺节点的生产以及20/14nm节点的工艺开发而设计的。与前代机型相比，E3630的测量重复性提高30%。新型的物镜和低振动平台使得量测性能得到显著提高。多探头检测系统和独特的算法使薄膜工艺(如EUV和硬掩模)的稳定及精确的量测成为可能。E3630在减少工艺开发周转时间(TAT)和提高下一代掩膜模生产效率方面做出重大贡献。

测定对象

- 最先进光掩模
- EUV 掩模
- 纳米压模模板
- 图形介质

先进的电子光学设计

E3630继承了专有的电子光学设计和独特的电子束扫描技术。通过独特的设计实现高分辨率成像，并且新开发的物镜显著降低了色差，进一步提高了低加速范围的分辨率。

精确的定位技术

新型定位系统保证了待测对象即使在高放大倍数下也能稳定定位，实现高通量、易观测的测量。

支持掩模新工艺的发展

支持硬掩模工艺等新工艺，配备多探头检测系统，即使在小于10nm的薄膜工艺下也能实现稳定，高精度的测量。

配搭新型边缘检测的算法，即使针对复杂的图形，能够提供无错误的识别率，从而提高生产力。

丰富的应用

- 通过对比CAD和SEM数据实现图像识别功能
- 使用大视场功能对大量图形进行边缘检测
- SECS/GEM功能用于生产自动化

数据兼容性

E3630软件与前代机型完全兼容并且可进行扩展。



ADVANTEST®

<http://www.advantest.com>

爱德万测试（中国）管理有限公司

上海市张江高科技园区华佗路168号3号楼C幢

邮政编码: 201203

Phone: +86-21-6163-2600

E-mail: PDL-AT-info_nano_atc@advantest.com